

## 大見研究室 和文 論文リスト

### 2004 年

- 1086(M) 大見忠弘、野沢俊久、寺本章伸、「省エネ型の半導体製造技術」、OHM 1月号、((株)オーム社)、pp.10-11、2004年1月。
- 1087-1(C) 寺本章伸、濱田龍文、赤堀浩史、二井啓一、小谷光司、大見忠弘、「Si(110)面を用いた低雑音バランスド CMOS 技術」、招待論文、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.103、No.556、((社)電子情報通信学会)、pp.37-40、2004年1月。
- 1087-2(C) 寺本章伸、濱田龍文、赤堀浩史、二井啓一、小谷光司、大見忠弘、「Si(110)面を用いた低雑音バランスド CMOS 技術」、シリコンテクノロジー、No.57、((社)応用物理学会シリコンテクノロジー分科会)、pp.36-39、2004年1月。
- 1088(M) 大見忠弘、「未来への洞察力を磨こう」、未来材料2月号、((株)エヌ・ディー・エス)、pp.73-77、2004年2月。
- 1089(C) 橋本誠司、大石潔、小坂光二、大石卓也、石川赳夫、久保田弘、大見忠弘、「摩擦モデルに基づく非共振型超音波アクチュエータ駆動精密ステージの一制御法」、産業計測制御研究会資料、((社)電気学会)、2004年3月。
- 1090(C) 大見忠弘、寺本章伸、今岡孝之、菅原広、石原良夫、吉田耕士、横井生憲、塚本和巳、白井泰雪、「半導体・ディスプレイ産業における省資源・省エネルギー化と使用済み薬液・ガスの完全回収・循環システム」、平成15年度産業技術総合研究所東北センター 研究講演会 講演要旨集—無機膜を利用したグリーンプロセスの開発—、(産業技術総合研究所 東北センター)、 pp.16-23、2004年3月。
- 1091(W) 赤堀浩史、塚本和巳、寺本章伸、大見忠弘、「Si(110)面の水素終端化とその安定性」、第15回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.1-8、2004年5月。
- 1092(C) 河瀬和雄、梅田浩司、井上真雄、辻川真平、赤松泰彦、寺本章伸、大見忠弘、「ラジカル窒化酸化膜中NのXPS評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.135、((社)電子情報通信学会)、pp.7-11、2004年6月。
- 1093-1(C) 濱田龍文、寺本章伸、赤堀浩史、二井啓一、諏訪智之、平山昌樹、大見忠弘、「界面平坦化を行ったシリコン(110)面上に形成されたトランジスタの電気的特性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.153、ED2004-81、((社)電子情報通信学会)、pp.41-44、2004年7月。
- 1093-2(C) 濱田龍文、寺本章伸、赤堀浩史、二井啓一、諏訪智之、平山昌樹、大見忠弘、「界面平坦化を行ったシリコン(110)面上に形成されたトランジスタの電気的特性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.156、SDM2004-81((社)電子情報通信学会)、pp.41-44、2004年7月。
- 1094-1(M) 大見忠弘、「事業化されない論文はただの紙切れだ」、MOT の真髓、No.001、(日経 BP 社 pp.56-61、2004年7月。
- 1094-2(M) 大見忠弘、「事業化されない論文はただの紙切れだ」、イノベーション・ジャパン 2004 特別版(日経ビジネス別冊)、(日経 BP 社)、pp.12-17、2004年8月。
- 1095(M) 大見忠弘、「ゆらぎの制御」、パネルディスカッション「閉塞感の打破と大学創りと」—ゆらぎの科学の立場から—、(日本ゆらぎ現象研究会)、pp.23-26、2004年7月。
- 1096(M) 宮本直人、カルナン・レオ、小谷光司、大見忠弘、「二次元高速フーリエ変換プロセッサ」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.74、2004年9月。
- 1097(M) 大川猛、藤林正典、山下雅房、宮本直人、カルナン・レオ、喜多総一郎、小谷光司、大見忠弘、「フレキシブル・プロセッサ(FP-2+)」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.84、2004年9月。

- 1098(M) 宮本直人、小谷光司、大見忠弘、「二次元画像認識プロセッサ」、VDEC 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.98、2004年9月。
- 1099(M) 花岡秀夫、大見忠弘、白井泰雪、「東北大学 未来情報産業研究館 スーパークリーンルーム:フラクチュエーションフリーファシリティ」、空気清浄、第42巻、第3号、((社)日本空気清浄協会)、pp.37-44、2004年9月。
- 1100(M) 大見忠弘、「大型 LCD 製造ラインに向けた環境への提言」、月刊ディスプレイ10月号、((株)テクノタイムズ社)、pp.1-6、2004年10月。
- 1101(C) 大見忠弘、「低温超高品質薄膜形成を可能にするラジカル反応ベース生産方式」、FPD International セミナー2004 テキスト、(UCTフォーラム)、pp.1-1-1-15、2004年10月。
- 1102(F) 須川成利、舘知恭、千葉浩児、赤羽奈々、小谷光司、大見忠弘、「リアルタイムオブジェクト分離を行なう高機能 CMOS イメージセンサ」、映像情報メディア学会誌、((社)映像情報メディア学会)、pp.134-139、2004年11月。
- 1103(C) 磯谷達典、高橋一郎、桜井弘之、後藤哲也、平山昌樹、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「原子状酸素を用いた酸化処理による強誘電体 STN 薄膜の特性改善」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.336、((社)電子情報通信学会)、SDM2004-174、pp.5-10、2004年10月。
- 1104(C) 河瀬和雅、梅田浩司、井上真雄、諏訪智之、樋口正顕、小村政則、寺本章伸、大見忠弘、「ラジカル窒化酸化膜における N の深さ分布と結合状態の制御」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.336、((社)電子情報通信学会)、SDM2004-178、pp.27-30、2004年10月。
- 1105(C) 千葉景子、坪井秀行、古山通久、久保百司、二井啓一、寺本章伸、大見忠弘、宮本明、「シリコン表面の化学反応性に関する量子化学的検討」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.337、((社)電子情報通信学会)、SDM2004-186、pp.21-22、2004年10月。
- 1106(C) 赤堀浩史、二井啓一、塚本和巳、寺本章伸、大見忠弘、「シリコン表面の自然酸化抑制」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.337、((社)電子情報通信学会)、SDM2004-187、pp.23-28、2004年10月。
- 1107(C) 日高敦志、山下哲、石井秀和、北野真史、棚橋直樹、白井泰雪、大見忠弘、「半導体・平板ディスプレイとそれらの製造設備用樹脂材料の分解抑制」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.337、((社)電子情報通信学会)、SDM2004-191、pp.35-40、2004年10月。
- 1108(C) 宮本直人、小谷光司、丸尾和幸、大見忠弘、「動的再構成 ALU を搭載した画像認識プロセッサ—高速フーリエ変換・逆変換に適した再構成コンピューティング—」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.104、No.336、((社)電子情報通信学会)、ICD2004-123、pp.13-18、2004年10月。
- 1109(C) 渡辺一史、小谷光司、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「RF 回路設計のための大振幅モデル」。シリコンテクノロジー、No.66、((社)応用物理学会シリコンテクノロジー分科会)、pp.51-56、2004年11月。
- 1110(W) 大見忠弘、『知的財産立国にむけて—東北における産学連携推進—知の創造拠点としての大学の役割』。知的財産シンポジウム(東北)、(経済産業省特許庁)、pp.19-31、2004年11月。
- 1111(W) 福田宗治、大見忠弘、須川成利、「エレクトロニクス産業用クリーンルームの消火に適応した Ar-Co<sub>2</sub> 不活性ガス消火装置の開発と実用化」、第16回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.35-42、2004年11月。
- 1112(W) 河瀬和雅、梅田浩司、井上真雄、諏訪智之、樋口正顕、小村政則、寺本章伸、大見忠弘、「ラジカル窒化酸化膜における N 深さ分布の制御」、第16回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.51-55、2004年11月。
- 1113(W) 大見忠弘、「新しい半導体技術の時代」、第16回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.85-95、2004年11月。
- 1114(W) 河瀬和雅、梅田浩司、井上真雄、辻川真平、赤松泰彦、諏訪智之、樋口正顕、小村政則、寺本章伸、大見忠弘、「ラジカル窒化酸化膜における N プロファイル制御」。第67回半導体・集積回路技術シンポジウム、(電気化学会電子材料委員会)、pp.72-75、2004年12月。